

## EB200 系列电子束光刻胶EB200-040

产品名称	EB200 系列电子束光刻胶EB200-040
公司名称	厦门良厦贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10190号（注册地址）
联系电话	0592-6013840 15396145919

## 产品详情

类型	光刻胶型号	适用光谱
AZ系列	AZ5214,AZ4620,AZ6130等	g/h/i-line
SU-8系列	SU-8 10系列，20系列等	g/h/i-line
PI	LTC9000系列	g/h/i-line
电子束胶	HSQ Fox-15/16	电子束

EB200 系列正性电子束光刻胶主要应用于射频芯片、光电子芯片、掩膜制作等领域，

用于亚微米光刻工艺中图形掩膜层制作，EB200 系列产品具有高分辨率、高感度、抗刻蚀等

优点，产品技术、原材料已实现自主可控。EB200 series positive E-beam resist is used in

sub-micron lithography process for RF chip, optoelectronic chip, mask layer production etc., EB200 series products have high resolution, sensitivity and dry etch resistance. 产品性能

膜厚范围:30-500nm；

高分辨率（20nm）；

高感度~60  $\mu$  C/cm<sup>2</sup> (Dose to clear)；

良好的工艺宽容度；

耐刻蚀性能；

安全溶剂;

## FEATURES

The thickness range : 30-500nm;

High resolution (20nm);

High Sensitivity ~60  $\mu$  C/cm<sup>2</sup> ;

Good process margin latitude;

Good dry etch resistance ;

Safety solvent;

## 产品型号及参数 PRODUCT RANGE & PARAMETER

Spin Curve Pattern Profiles

Sensitivity curve Dry etch resistance

Product name EB200-040 EB200-030 EB200-020 EB200-012

Film thickness 650-350nm 500-250nm 300-200nm 200-30nm

E

B

2

0

0

S

er